

Pressemitteilung

MEMS-Hersteller aufgepasst

Neue Interferenzfilter für die Fotolithographie

Fotolithographische Filter kommen bei Anwendungen in LSI und LCD Steppern zum Einsatz, bei denen Hochleistungs-Quecksilberdampflampen für die Belichtung eingesetzt werden. Die sehr schmalbandigen Bandpassfilter erzeugen eine quasi-monochromatische Strahlung. Hierdurch wird auf dem Target die bestmögliche Auflösung erreicht.

LASER COMPONENTS bietet neue i-line Bandpassfilter mit Filterdesigns auf Basis der Dual Magnetron Reactive Sputtering Beschichtungen an. Die i-line Intensität ist dadurch deutlich verbessert, ebenso wie die Homogenität im fotolithographischen Prozess.

Vom Hersteller dieser Filter, Omega Optical, kommt ein weiteres Produkt, welches besonders interessant für die MEMS-Herstellung ist. MicroChem, der Hersteller des Fotolacks SU-8, empfiehlt, UV-Strahlung unterhalb von 350 nm zu blocken, um besonders lotrechte Strukturen zu erzeugen. In diesem Zusammenhang wird der Typ PL-360-LP aus der Mask-Aligner Serie besonders empfohlen.

Weitere Infos

<http://www.lasercomponents.com/de/produkt/fotolithografische-filter/>

Messen

BiOS 2012, 21.-22.01.2012, The Moscone Center, San Francisco, **South Hall – Stand 8517**
Photonics West 2012, 24.-26.01.2012, Moscone Center, San Francisco, **South Hall – Stand 517**
Analytica 2012, 17.-20.04.2012, Neue Messe München, **Stand A2.400A**

Das Unternehmen

LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert. Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in vier Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an drei Standorten in Deutschland, Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 130 Mitarbeiter.

Bei Veröffentlichung Belegexemplar erbeten.